

ЛАВИНО-ПРОЛЕТНЫЙ ДИОД — полупроводниковый диод, обладающий отрицательным дифференциальным сопротивлением в СВЧ-диапазоне вследствие развития т. н. лавинно-пролётной неустойчивости. Последняя обусловлена ударной ионизацией и дрейфом носителей заряда в $p-n$ -переходе в режиме обратного смещения (см. $p-n$ -переход). Идея, лежащая в основе работы Л.-п. д., сформулирована в 1958 У. Т. Ридом (W. T. Read). Генерация на Л.-п. д. впервые наблюдалась в СССР в 1959 А. С. Тагером с сотрудниками [1].

Физ. принцип работы Л.-п. д. можно пояснить на примере диода Рида (рис. 1). Диод состоит из сильно легированного p^+ -эмиттера и неоднородно легированной n -базы (рис. 1, а). Узкий слой n -базы вблизи $p-n$ -перехода легирован сильно (n^+ -слой), остальная часть

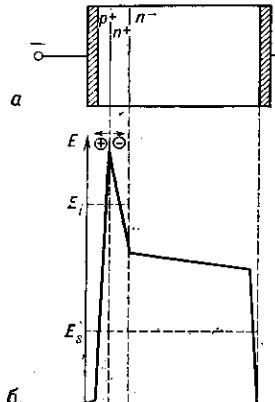


Рис. 1.

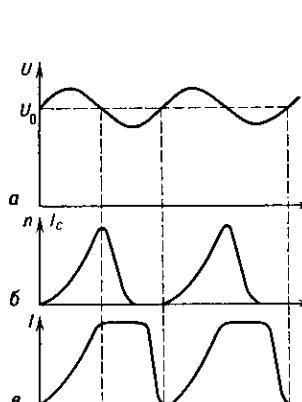


Рис. 2.

базы легирована слабо (n^- -слой). Распределение поля в такой структуре для обратного напряжения U_0 , большего, чем напряжение пробоя U_i , показано на рис. 1 (б). При этом напряжённость поля в области $p-n$ -перехода превышает поле ударной ионизации E_i и вблизи $p-n$ -перехода генерируются электронно-дырочные пары (область умножения). Дырки быстро пролетают к электроду сквозь узкий сильно легированный эмиттер, не оказывая существенного влияния на работу прибора. Электроны, покинув область умножения, пролетают затем протяжённую слабо легированную n^- -область (область дрейфа а).

В области умножения и в области дрейфа электроны движутся с одной и той же, не зависящей от напряжённости поля дрейфовой скоростью — скоростью насыщения v_s [2]. Значение поля E_s , при к-ром дрейфовая скорость электронов насыщается, составляет для электронов в Si и GaAs величину $\sim 10^4$ В/см, значительно меньшую значения поля в области умножения $E_i \approx (3-5) 10^5$ В/см. Характерное значение $v_s \approx 10^7$ см/с.

Пусть помимо пост. напряжения U_0 к диоду приложено перемен. напряжение U частотой ω (рис. 2, а). С ростом напряжения U происходит резкое увеличение концентрации носителей в области умножения вследствие экспоненциального характера зависимости коэффициента ударной ионизации от поля [2]. Однако т. к. скорость роста концентрации электронов dn/dt пропорц. уже имеющейся в области умножения концентрации n , момент, когда n достигает максимума, запаздывает по отношению к моменту, когда максимума достигает напряжение на диоде (рис. 2, б). В условиях, когда v_s не зависит от поля, ток проводимости в области умножения I_c пропорц. концентрации n : $I_c = env_s S$ (e — заряд электрона, S — площадь диода). Поэтому кривая на рис. 2 (б) представляет собой также и зависимость тока I_c в области умножения от времени.

Когда напряжение на диоде спадает и концентрация носителей в области умножения резко уменьшается,

ток на электродах прибора I (полный ток) остаётся постоянным (рис. 2, в). Сформировавшийся в области умножения сгусток электронов движется через область дрейфа с пост. скоростью v_s . Пока сгусток электронов не уйдёт в контакт, ток через диод остаётся постоянным (теорема Рамо — Шокли) [3]. Из сравнения рис. 2, а и 2, в видно, что ток, протекающий через Л.-п. д., колеблется практически в противофазе с напряжением, т. е. имеет место отрицат. дифференциальное сопротивление.

Отрицат. дифференциальное сопротивление Л.-п. д. является частотно-зависимым. Время пролёта носителей через область дрейфа $t_0 \approx L/v_s$, где L — длина области дрейфа, практически равная полной длине диода. Сдвиг фаз между током и напряжением $\sim \pi$ может быть реализован только на частоте $\omega \sim 1/t_0 \sim v_s/L$ (и на гармониках). Более точный расчёт устанавливает соотношение между ω и L :

$$\omega \approx \pi v_s/L.$$

Механизм возникновения отрицат. дифференциального сопротивления является малосигнальным: колебания спонтанно нарастают в резонаторе, настроенном на соответствующую частоту ω , при подаче на диод достаточно большого пост. смещения.

Наиб. мощные и эффективные Л.-п. д., предназначенные для работы в сантиметровом диапазоне и длинноволновой части миллиметрового диапазона длин волн, изготавливаются из GaAs, а для работы на более высоких частотах — из Si. Перспективно использование InP и др. соединений типа Al_xBr_y, а также гетероструктур и сверхрешёток.

Для создания Л.-п. д. используются диффузия и ионная имплантация примесей, эпитаксиальное наращивание (см. Эпитетаксия), напыление металла в вакууме.

Л.-п. д. — наиб. мощный полупроводниковый прибор для генерации и усиления эл.-магн. колебаний на частотах до 400 ГГц. Л.-п. д. из GaAs на частоте 6 ГГц в непрерывном режиме обеспечивают выходную мощность $P=15$ Вт при $\eta \approx 30\%$; на частоте 40 ГГц $P \approx 2$ Вт при $\eta \approx 20\%$. Кремниевые Л.-п. д. позволяют получить $P \approx 1$ Вт на частоте 100 ГГц и 50 мВт на частоте 200 ГГц и 2 мВт на частоте 440 ГГц.

Лит.: 1) Тагер А. С., Вальд-Перлов В. М., Лавинно-пролётные диоды и их применение в технике СВЧ, М., 1968; 2) З и С., Физика полупроводниковых приборов, пер. с англ., кн. 2, М., 1984; 3) Кэрролл Дж., СВЧ-генераторы на горячих электронах, пер. с англ., М., 1972.

М. Е. Левинштейн, Г. С. Симин.

ЛАГЕРРА ФУНКЦИИ — ф-ции, являющиеся решеними ур-ний

$$xf'' + -(\alpha + 1 - x)f' + nf = 0,$$

где α , n — произвольные параметры. Если n — целое положит. число, Л. ф. вырождаются в полиномы Лагерра $L_n^\alpha(x)$ (см. Ортогональные полиномы). В общем случае Л. ф. выражаются через вырожденную гипергеометрическую функцию

$$L_n^\alpha(x) = \Phi(-n, \alpha + 1, x) \Gamma(\alpha + n + 1)/n! \Gamma(\alpha + 1).$$

Иногда вводят Л. ф., убывающие при $x \rightarrow +\infty$: $f_n^\alpha(x) = e^{-x/\alpha} x^{\alpha/2} L_n^\alpha(x)$. Эти ф-ции ортогональны на интервале $(0, +\infty)$; применяются в задачах о распространении эл.-магн. волн в длиных линиях, о движении электрона в кулоновом поле и т. д.

ЛАГРАНЖА УРАВНЕНИЯ гидромеханики — дифференциальные ур-ния движения частиц несжимаемой идеальной жидкости в переменных Лагранжа (см. Гидроаэромеханика), имеющие вид

$$\left(X - \frac{\partial^2 x}{\partial t^2} \right) \frac{\partial x}{\partial a_i} + \left(Y - \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \right) \frac{\partial y}{\partial a_i} + \left(Z - \frac{\partial^2 z}{\partial t^2} \right) \frac{\partial z}{\partial a_i} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial a_i} \quad (i = 1, 2, 3),$$

где t — время, x , y , z — координаты частицы жидкости, a_1 , a_2 , a_3 — параметры, с помощью к-рых отличают